

# 次観測装置用の新しい 回折格子の開発状況 VI

海老塚 昇<sup>1</sup>, 岡本 隆之<sup>1</sup>, 竹田 真宏<sup>1</sup>, 細畠 拓也<sup>1</sup>, 山形 豊<sup>1</sup>,  
佐々木 実<sup>2</sup>, 魚本 幸<sup>3</sup>, 島津 武仁<sup>3</sup>, 佐藤 慎也<sup>4</sup>, 橋本 信幸<sup>4</sup>,  
田中 壱<sup>5</sup>, 服部 尧<sup>5</sup>, 尾崎 忍夫<sup>6</sup>, 青木 和光<sup>6</sup>

<sup>1</sup>理化学研究所, <sup>2</sup>豊田工業大学 工学部, <sup>3</sup>東北大学 学際科学フロンティア研究所, <sup>4</sup>シチズン時計 研究開発センター,  
<sup>5</sup>国立天文台 ハワイ観測所, <sup>6</sup>国立天文台 TMT推進室



# 表面刻線型回折格子の限界

$$\sin \theta_0 = n \sin \theta_1$$

$$n \sin(\alpha - \theta_1) = \sin \theta_2$$

$$\theta_2 = \alpha + \theta_0$$

$$n \sin(\alpha - \theta_1) = \sin(\alpha + \theta_0)$$

$$n (\sin \alpha \cos \theta_1 - \sin \theta_1 \cos \alpha)$$

$$= \sin \alpha \cos \theta_0 + \sin \theta_0 \cos \alpha$$

$$(n \cos \theta_1 - \cos \theta_0) \sin \alpha$$

$$= (\sin \theta_0 + n \sin \theta_1) \cos \alpha$$

$$= 2 \sin \theta_0 \cos \alpha$$

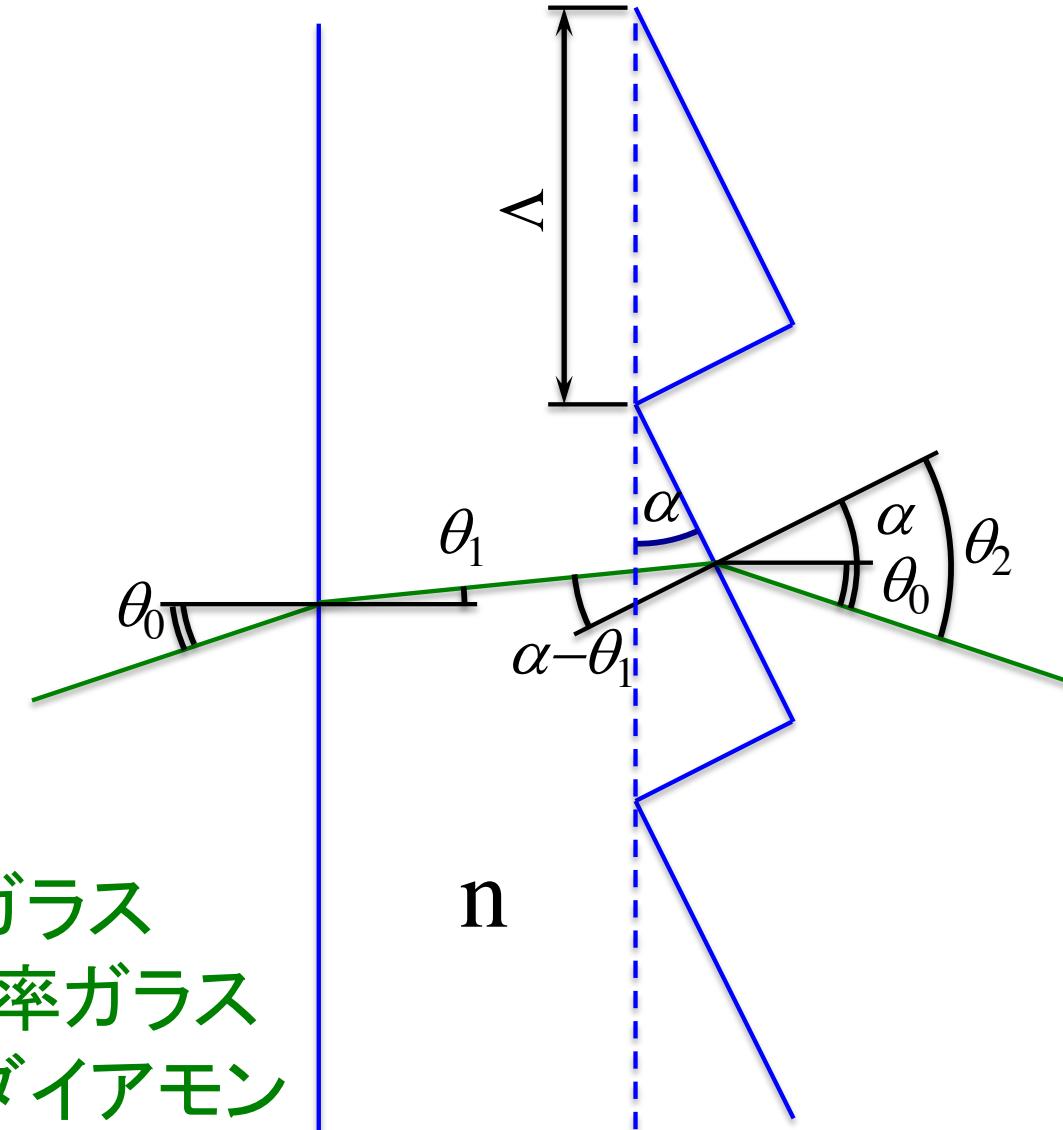
$$\tan \alpha = 2 \sin \theta_0 / (n \cos \theta_1 - \cos \theta_0)$$

$n = 1.5, \theta_0 \leq 29^\circ$  ( $\theta_2 > 90^\circ$ ) 光学ガラス

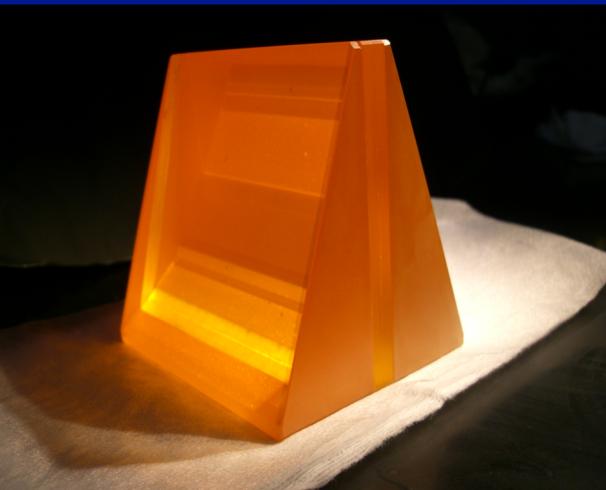
$n = 2.0, \theta_0 \leq 40^\circ$  (同上) 高屈折率ガラス

$n = 2.5, \theta_0 \leq 48^\circ$  (同上) ZnSe, ダイアモン

ド 従来のノコギリ歯形状の表面刻線型回折格子は大きな回折角 ( $\infty$ 角度分散) 用には使用できない。



# 開発中の各種回折格子



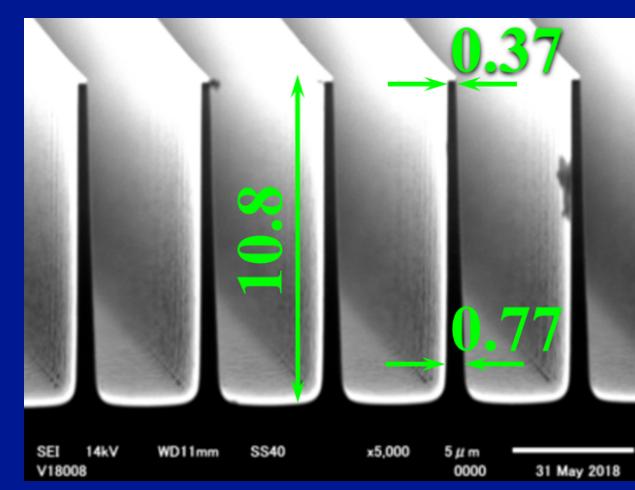
VPHグリズム



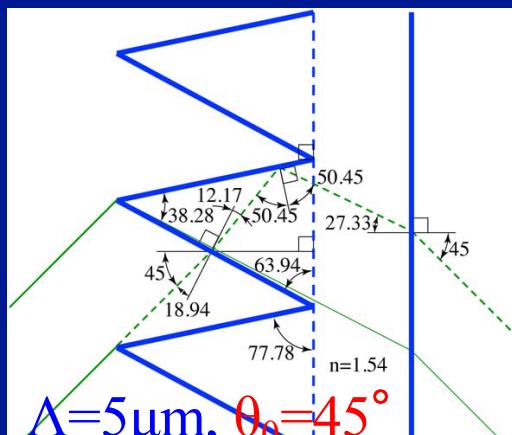
複屈折性のB-  
VPH grating



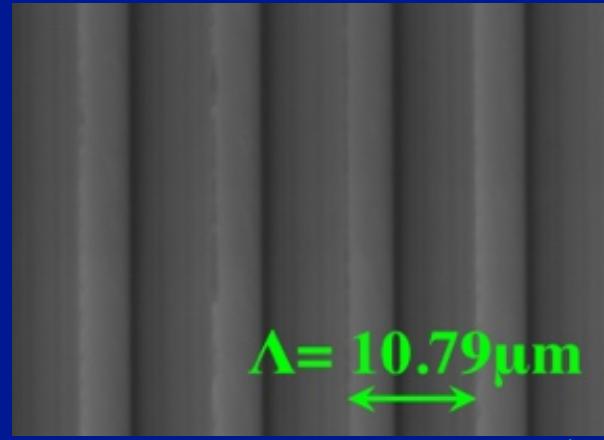
Quasi-Bragg  
(QB) grating



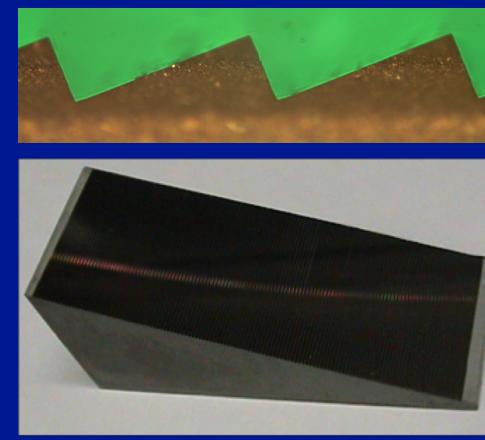
Volume binary  
(VB) grating



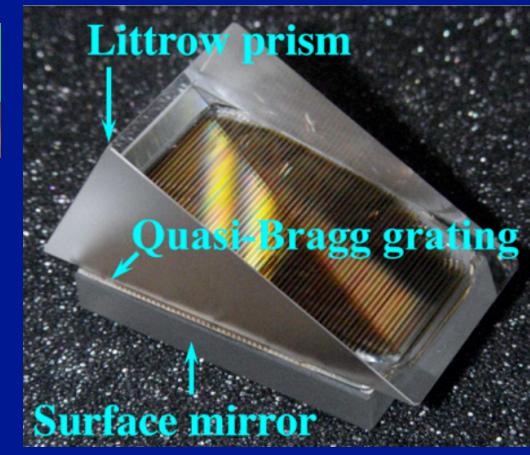
Reflector facet  
transmission  
(RFT) grating



MOIRCSハイブ  
リッド・グリズム

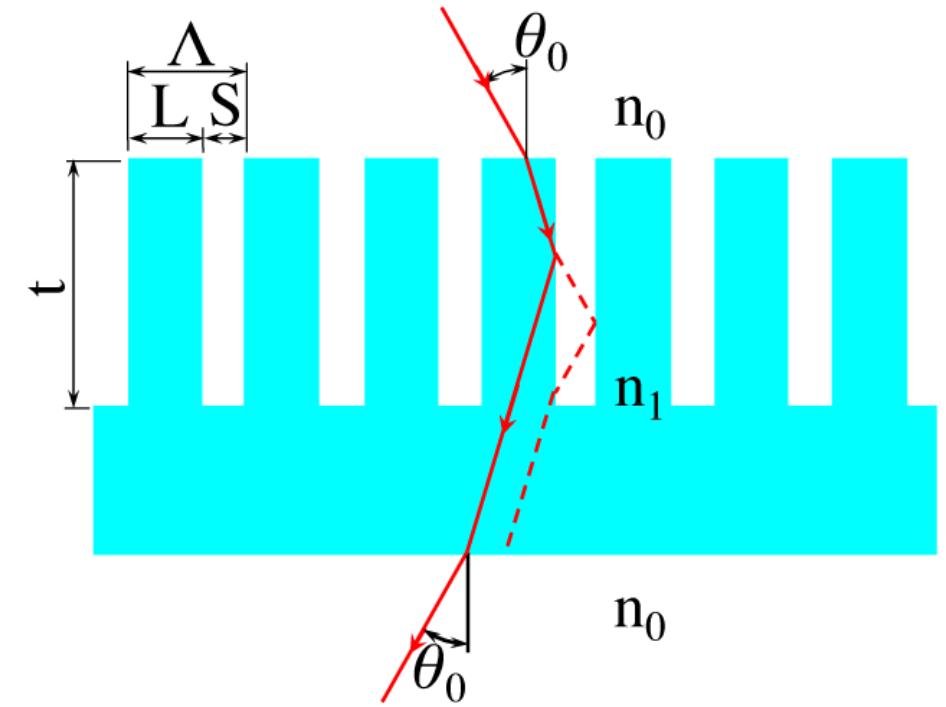
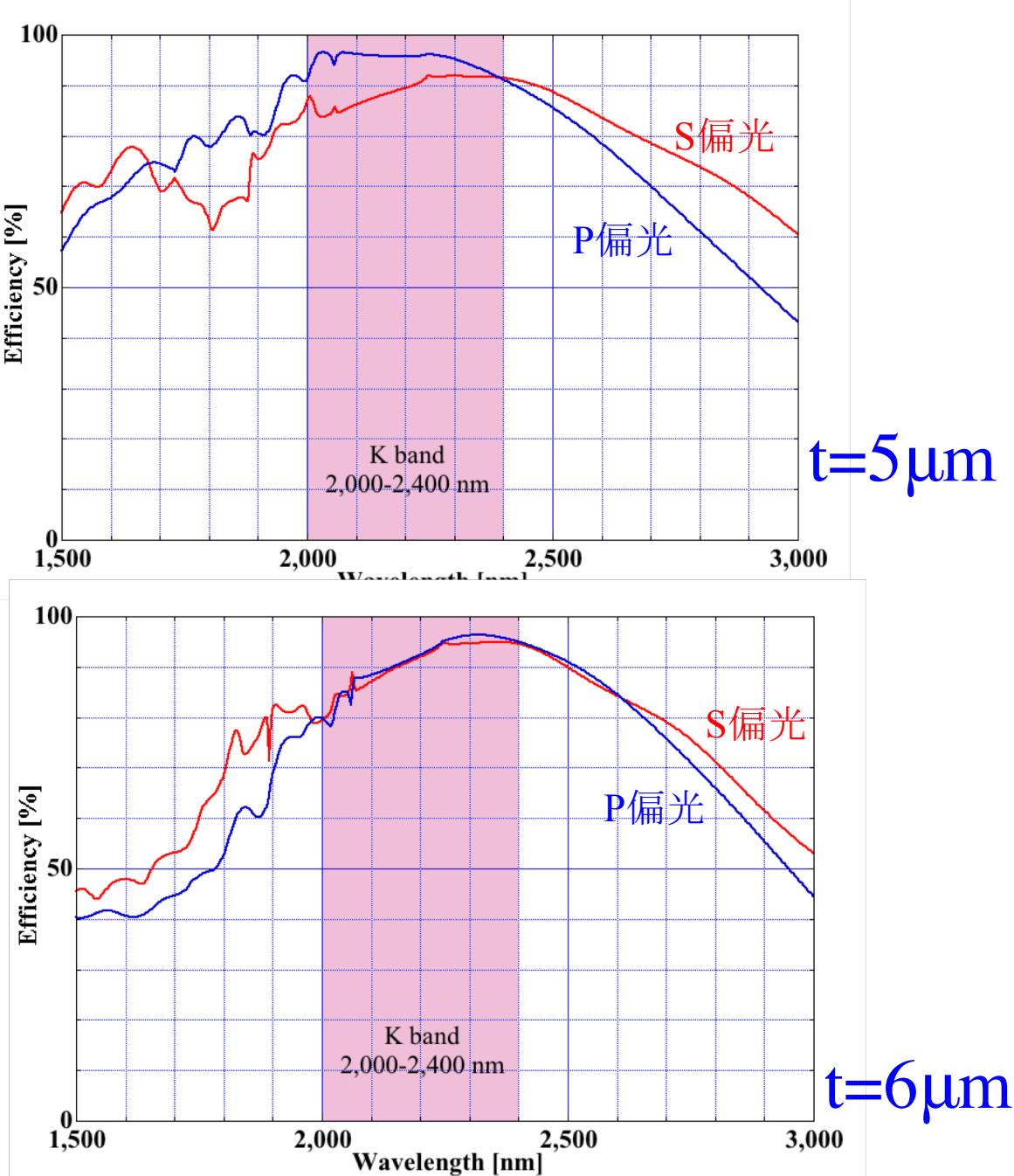


Immersion  
grating



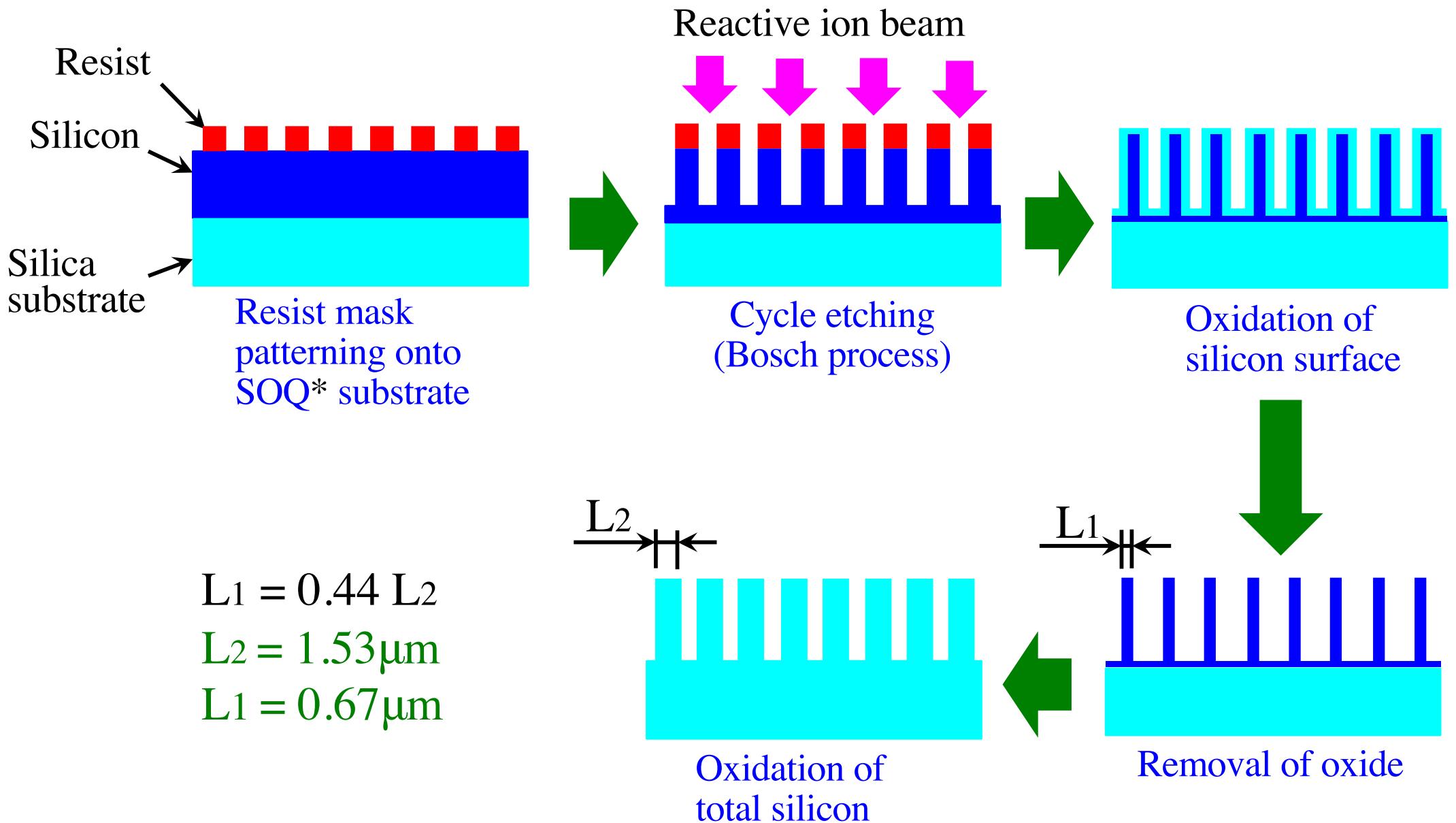
QB immersion  
grating

# Volume Binary Grating



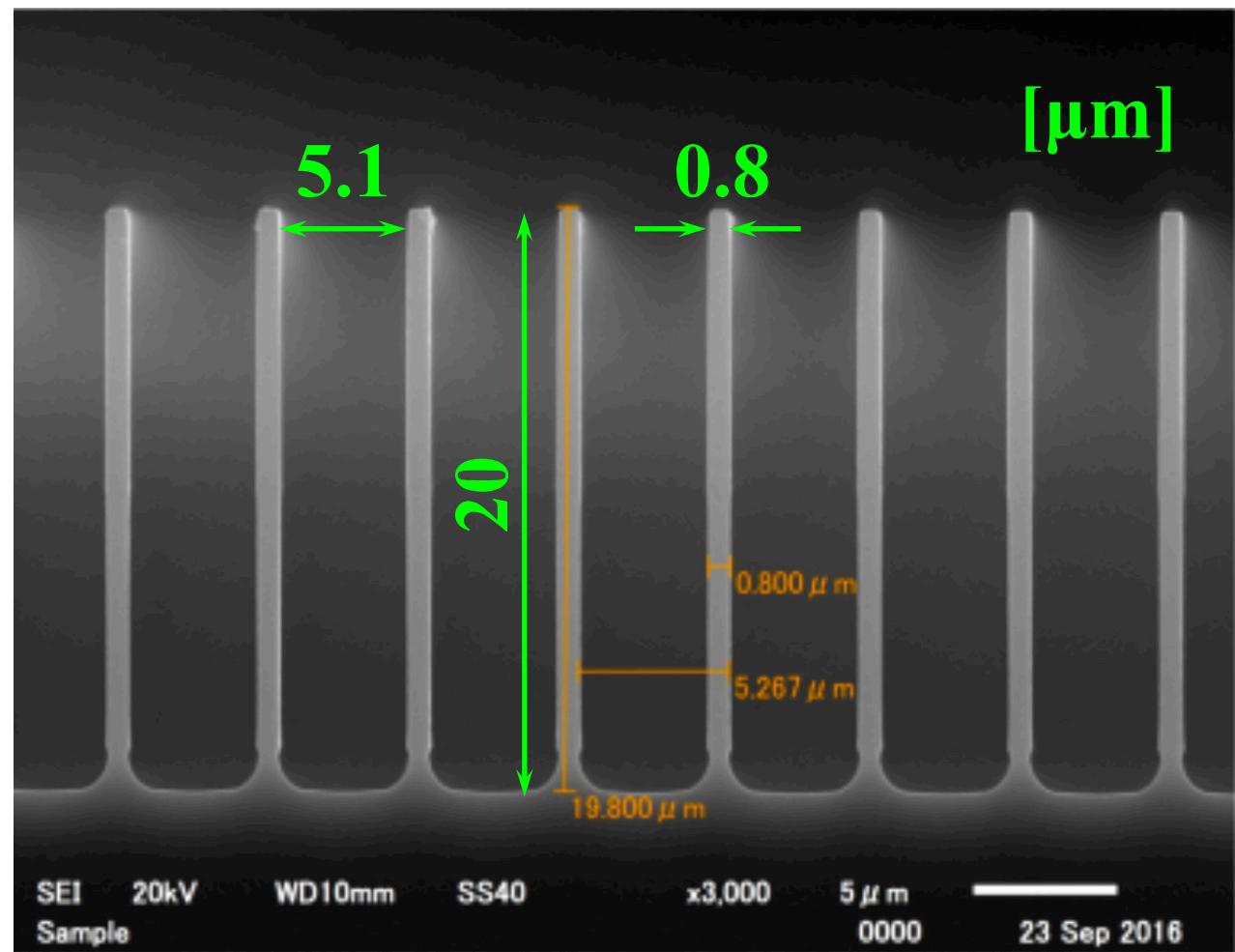
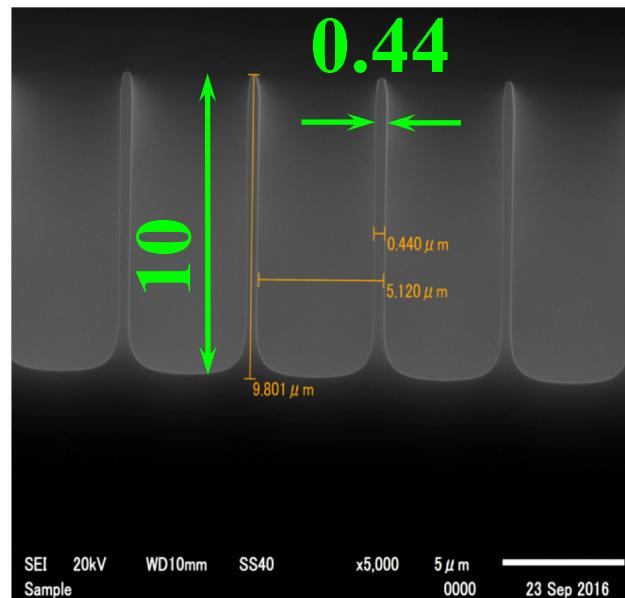
**MOIRCS Kバンド グリズム**  
 サイズ:  $70 \times 70$  [mm]  
 材質: 石英  
 格子周期:  $\Lambda = 2.36\mu\text{m}$  ( $423.7$  g/mm)  
 窓の幅:  $L = 1.53\mu\text{m}$   
 溝の幅:  $S = 0.83\mu\text{m}$   
 窓の高さ:  $t = 5.5\mu\text{m}$

# Fabrication Method for VB Grating



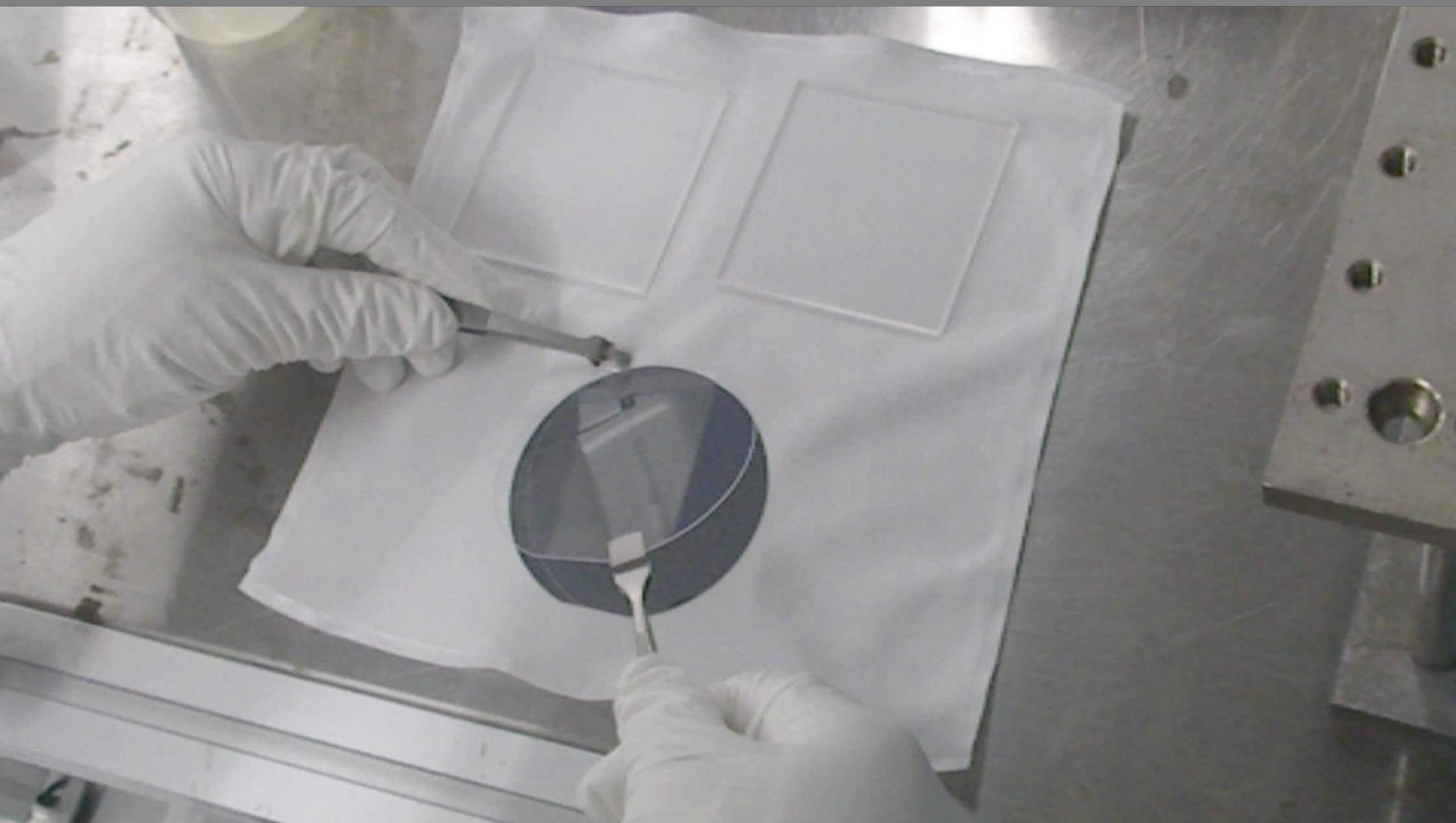
\* SOQ: Silicon on Quartz

# シリコンの高アスペクト比矩形格子(Quasi-Bragg Grating)の試作



サイクルエッチング(Boschプロセス)→シリコン酸化 $\leftrightarrow$ 酸化膜除去により加工された高アスペクト比のシリコン矩形格子(格子周期 $\Lambda = 5.1 \mu\text{m}$ )。豊田工業大学ナノテクノロジープラットフォームにて加工。

# Test Fabrication of SOQ Substrate



Fabricated by the Nanotech PF of Toyoda Institute of Technology